

反应离子刻蚀机

SAMCO RIE-10NR

一、简介:

RIE-10NR是一种新型的低成本、高性能、全自动反应离子刻蚀系统，能够满足非腐蚀性气体化学最苛刻的工艺要求。

计算机化触摸屏为工艺配方编程和存储提供了用户友好的界面。

该系统可以实现精确的侧壁轮廓控制和材料之间的高蚀刻选择性。

凭借其圆滑、紧凑的设计，RIE-10NR只需要很小的洁净室空间。

二、应用:

硅、二氧化硅、氮化硅、多晶硅、砷化镓、钼、铂、聚酰亚胺等材料的腐蚀失效分析中的选择性层腐蚀。



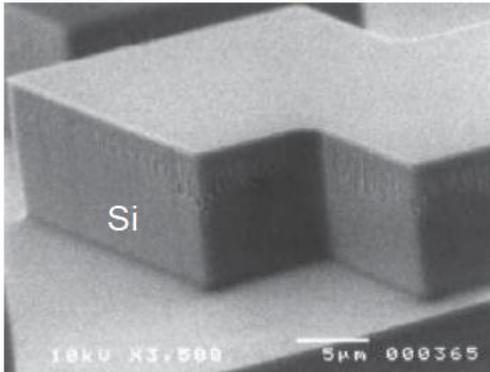
仪准科技(香港)有限公司

Advanced Technology Co., Limited

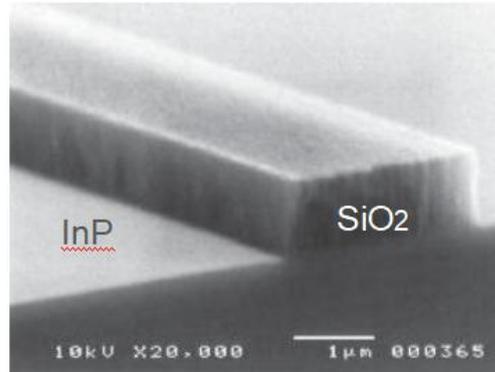
TEL:021-34638926 FAX:021-64051950

Email:cypher_wang@adv-hk.com <http://www.adv-hk.com>

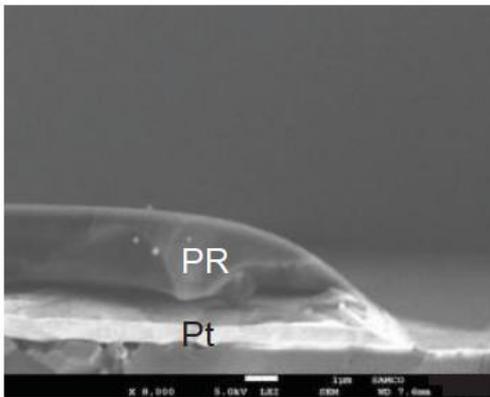
Anisotropic etching of Si



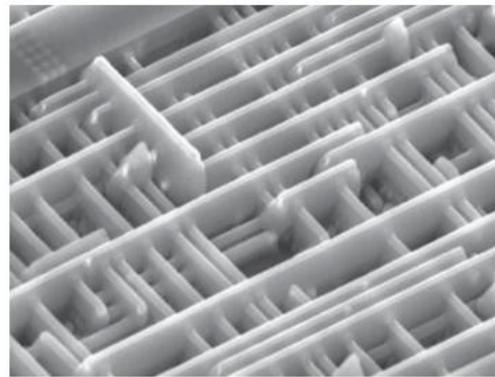
Fabrication of SiO₂ mask



Sputter etching of Pt



5-layer Al lines exposure



三、主要功能和优点:

- 1、加工至 $\phi 220$ mm ($\phi 3$ "x 5, $\phi 4$ " x 3, $\phi 8$ " x 1) 。
- 2、高选择性各向异性蚀刻满足严格的工艺要求全自动“一键式”操作。
- 3、自动压力控制, 允许独立于气流干泵和系统布局的过程压力精确控制, 便于维护。

仪准科技(香港)有限公司

Advanced Technology Co., Limited

TEL:021-34638926 FAX:021-64051950

Email:cypher_wang@adv-hk.com <http://www.adv-hk.com>



4、于Windows的用户界面，丰富的配方和内置的数据记录功能，是一个可靠和持久的系统，全球安装了400多个系统。

四、主要参数规格：

基板	220 mm (ø3 “x 5, ø4” x 3, ø8” x 1)
负载	开放式
上下电极	ø240 mm
射频功率	300瓦@13.56兆赫，自动匹配（500瓦为选项） 可切换射频供电电极（阳极/阴极模式）为选项
气体管道	内部2条MFC控制的气体管道（最多6条）
泵	干泵（500升/分钟）
操作系统	触摸屏操作（可选择基于Windows的用户界面）、配 方管理
端点检测	光学发射光谱（OES）作为一种选择
尺寸	500 mm（宽）x 920 mm（深）x 1501 mm（高）

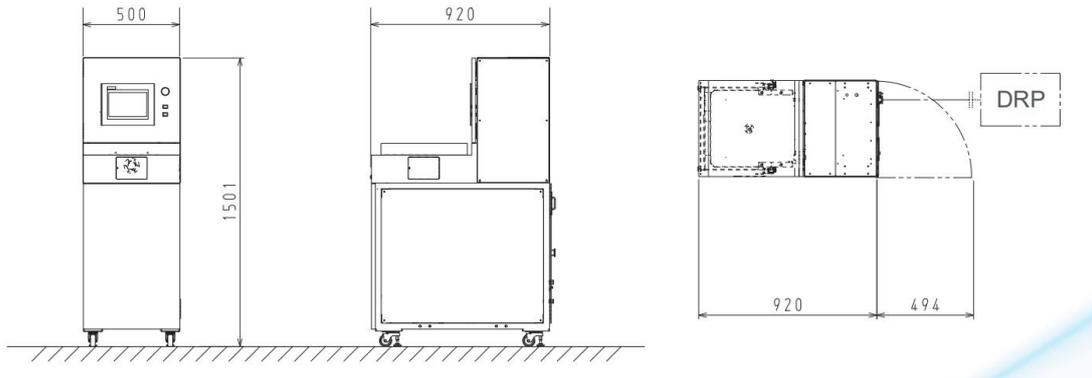
仪准科技（香港）有限公司

Advanced Technology Co., Limited

TEL:021-34638926 FAX:021-64051950

Email:cypher_wang@adv-hk.com <http://www.adv-hk.com>

unit: mm



儀準科技(香港)有限公司

Advanced Technology Co., Limited

TEL:021-34638926 FAX:021-64051950

Email:cypher_wang@adv-hk.com <http://www.adv-hk.com>